高度集積電子デバイス等に向けたナノ材料用特性評価システムの開発

森田寛之*1 鈴木浩之*1 廣島啓太*2 増淵維摩*3

Development of an Assessment System of Properties of Nano Materials for High Integrated Devices and etc.

MORITA Hiroyuki*¹, SUZUKI Hiroyuki*¹, HIROSHIMA Keita*², MASUBUCHI Yuma*³

抄録

高集積度デバイスの微細化・高度化に伴い、デバイスの発熱・排熱は喫緊の課題である。 デバイス上の微細配線では量子効果による物性値に大きな変化があると予想されている。 そこで、ナノ加工により測定用の電気配線したナノワイヤーを用いて、Labviewやデジタ ルマルチメーター等を用いて3ω法による熱伝導率を評価する測定システムの開発を試み た。

キーワード:3ω法、ナノワイヤー、ナノ加工、Labview

1 はじめに

産業の高度化に伴い、高性能かつ低消費電力の 高集積度デバイスの微細加工が進められている。 デバイス内のトランジスタやFET等の個々の半導 体では低い消費電力であるが、数千万~数億個の 半導体が集積されたデバイスとしての消費電力は 増大し、発生する熱も大きくなる。そのため、デ バイス設計時の半導体の配置や配線を適切に行う ことで、熱の局所的発生を抑え、効率的な排熱が 重要となる。このとき、各材料の熱物性値が重要 であり、特に数十nm以下の超微細形状では量子 効果による物性値の変化が現れると報告されてい ることから^{1)~3)}、今後ナノ加工された材料の熱 特性の評価を求められることが予想される。

そこで、本研究では、微細なワイヤー形状の電 気伝導体の熱特性を評価することができるシステ ムの開発を進める。

- *¹ 技術支援室 電気·電子技術担当
- *2 技術支援室 材料技術担当
- *3 事業化支援室 製品開発担当

2 3ω法の原理

両端を固定して宙に吊したワイヤーの温度 T_o の時の抵抗を R_o とすると、温度変化 Tのワイヤーの抵抗 R_T は、

$$R_T = R_0 (1 + \alpha_T T) \tag{1}$$

となる。係数 a_T は、ワイヤー材料の温度係数を 示す。ワイヤーの両端に熱容量の大きいブロック を接触させ、ワイヤーに実効値 I_o 、角周波数成 分 ω の交流電流Iを通電したとき、ワイヤー両端 の電圧 V_R は

$$V_{R} = IR_{T} = I_{0}R_{0}(1+\alpha_{T})T\sin(\omega t) \qquad (2)$$

$$\geq t_{R} \gtrsim_{0}$$

ワイヤーに発生するジュール熱 W は、温度変化 による抵抗変化が非常に小さいもの ($\alpha_T T <<1$) と考えると、以下の式となる。

$$W = V_R R_T = \frac{I_0^2 R_0}{2} \left(1 - \cos(2\omega t) \right)$$
(3)

ジュール熱Wと温度変化Tの関係は

$$T \propto W$$
 (4)

とみなせることから、温度変化 T は

埼玉県産業技術総合センター研究報告 第14巻(2016)

$$T = T_0 (1 - \cos(2\omega t))$$
(5)
となる。 T_0 は定数である。
以上のことから、電圧 V_R は下記の式となる。
 $V_R = IR_T = I_0 R_0 \sin(\omega t)(1 + \alpha_T T)$
 $= I_0 R_0 \sin(\omega t)(1 + \alpha_T T_0 (1 - \cos(2\omega t))))$
 $= V_{1,x} \sin(\omega t) + V_{1,y} \cos(\omega t) + V_{3,x} \sin(3\omega t)$ (6)
式 (6) のように、温度変化により角周波数成分
3 ω の電圧が発生する。 $V_{3,x}$ を測定し、試料のサ
イズ、温度係数の値から解析することにより熱伝
導率を求めることが可能となる^{4) ~60}。

(-)

 $a = a \left(2 \left(a \right) \right)$

3 試験方法

T

本研究では、計測・制御を行うことで熱物性を 評価するための評価システムの構築を行った。次 に測定対象となるワイヤー形状の試料作製および ナノ加工による電気配線、ワイヤーを宙吊りにす るためのエッチングを行った。

3.1 評価システムの概要

本評価システムは主に、(1)温度制御、(2) 角周波数ωの交流電流通電、(3)角周波数 3ω の交流電圧計測の機能を有するものとした。本研 究では、図1のようなフローチャートに基づき、 図2に示す電子計測器間をGPIBで接続し、アプ リケーション作成に Labview を用いて評価システ ムの開発を試みた。



図1 評価システムのフローチャート

cii.	デジタルマルチメーター G	B IC L OBIRT
2-	By949797	
	交流電流道	
(Laboratory)	82828	

図2 ナノ材料特性評価システムの概略図

さらに、計測対象の試料への適切な(1) 電気 接合、(2) 電気配線、(3) 試料露出のためのエ ッチングの技術の開発も行った。測定試料とし て、熱伝導率が性能評価のパラメータであり、加 工を行ったことのある⁽⁷⁾石英ガラスに覆われたビ スマスナノワイヤーを用いることにした。試料の 加工完成図を図3に示す。



図3 試料の加工完成図

3.2 試料の作製

図4のように、直径200~300nmの空孔を有す る石英ガラステンプレートを高温下で溶融したビ スマスを空孔に圧入・冷却し、成形・研磨を行 い、ビスマスナノワイヤーを作製した(図5)。



図4 ビスマスナノワイヤーの作製方法



図5 作製したビスマスナノワイヤー

作製した試料は、ビスマスナノワイヤー側面表 面から数µm 厚の石英ガラスを残して研磨し

た。その後、石英ガラスに覆われた直径約 200~ 300nm のビスマスナノワイヤーに電気配線を行 うため、下記の(1)~(3)の加工を行った。 (1)イオンプレーティング装置を用いて、研磨し

た試料にチタン、銅の順で成膜した。

- (2)対象物へ Ga イオンビームを照射して局所的 に切削するミリング機能を有する集束イオン ビーム装置により、石英ガラスに覆われたビ スマスナノワイヤー側面をナノ加工により露 出させた。次に露出した側面とチタン/銅電極 膜間を図 6(a)~(d)のようにタングステン膜成 膜にて電気配線を行った。
- (3) チタン/銅電極膜が電極パッドとなるよう、パ ターン加工を施した。



図6 ビスマスナノワイヤーへの電気配線概略図

4 結果及び考察

4.1 ペルチェモジュールを用いた温度制御 システム

本評価システムでは、電圧測定を行うことでジ ュール熱による電気抵抗の変化を評価する方法を とった。そのため、測定試料に印加される温度を 精密に制御する必要があることから、図7のとお り、ペルチェモジュールを用いて温度制御を行っ た。

また、電気エネルギーの供給源には直流電源 (Agilent 製 E3643A)を用い、温度測定に K 型 熱電対とデジタルマルチメーター (Keithley 2110)にて測定し、計測・制御ソフトである Labview を用いた。PID 制御により温調しながら 1 秒間隔でサンプリングを行った。

評価プログラムを用いて温度設定を 300K にし

た時、ペルチェ素子表面の温度の計測値は 299.9 ~300.0K を示した。

また、デジタルマルチメーターで得られた電 流、電圧値を一定時間間隔で取り込み、さらに抵 抗値を計算して Excel ファイルに計測データを書 き込み可能なプログラムを作成した。現在開発中 の Labview によるプログラム画面を図 8 に示す。







図 8 開発中の Labview プログラム画面

4.2 集東イオンビーム装置を用いた電気配 線加工

図 6 のとおり、集束イオンビーム装置(日本電 子 JIB4600F)を用いて作製したビスマスナノワ イヤーにナノ加工を行い、電圧測定のための電気 配線を行った。集束イオンビームの加速電圧や照 射電流を調整し、ミリングを行いながら、SEM にてビスマスナノワイヤーの側面が露出したこと を確認した。その後、タングステンへキサカルボ ニルのガスを流しながら加速電圧や照射電流を調 節した電子ビームを照射して局所的に成膜を行 い、チタン/銅電極膜-露出させたビスマスナノ ワイヤー間の電気接続を行った。ナノ加工を行っ た試料の SEM 像を図 9、さらにチタン/銅電極膜 のパターン加工した試料の写真を図 10 に示す。

謝 辞



図9 電気配線を行った試料 SEM 像



図 10 パターン加工を行った試料写真

5 まとめ

以上、本研究結果を下記に示す。

- (1) PID 制御により、ペルチェモジュールの温度 制御を行い、計測データを一定間隔で Excel データに書き込み可能な評価システムを構築 した。
- (2) 石英ガラスに覆われたビスマスナノワイヤー を作製し、ナノ加工およびタングステン膜成 膜により電気配線を行った。

今後、角周波数 3ω成分の交流電圧を測定す るため、ロックインアンプを用いて、角周波数 成分 3ωの信号を取得する機能を評価システム に追加し、測定データから熱伝導率を解析でき るよう評価システムの開発を進めていく。

さらに、エッチングおよびナノ加工を行うこと でビスマスナノワイヤーの熱伝導率が評価できる ように試料を作製・加工し、本開発プログラムを 用いて熱伝導率の評価が可能か検討する。 本研究を進めるに当たり、御指導いただきまし た埼玉大学の長谷川靖洋准教授に感謝の意を表し ます。

- Yu-Ming Lin, Xiangzhong Sun, and M. S. Dresselhaus:Thermoelectrical investigation of thermoelectric transport properties of cylindrical Bi nanowire, Phy. Rev.B,62,7,4601 (2000)
- Yasuhiro Hasegawa, Masayuki Murata, Daiki Nakamura and Takashi Komine:Reducing thermal conductivity of thermoelectric materials by using a narrow wire geometry, JJAP, 106, 0637703(2009)
- L.D. Hicks and M. S. Dresselhaus, Phys. Rev. B 47,12727 (1993)
- 4) Chris Dames and Gang Chen:1ω, 2ω and 3ω methods for measurements of thermal properties, Rev. Sci, Instrum, 76124902(2005)
- 5) L.Lu. Yi and D. L. Zhang: 3ω method for specific heat and thermal conductivity measurements, Rev. Sci, Instrum, 72, 7, 2996 (2001)
- 6) Yasuhiro Hasegwa , Masayuki Murata, Fumiaki Tsunemi, Yusuke Saito, Katsuhito Shirota, Takashi Komine, Chris Dames and Javier E. Garay:Thermal Conductivity of an Indivisual Bismuth Nanowire Coverd with Quartz Template Using a 3-Omega Thechnique, J. Electron. Mater. 42, 2048(2013)